

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成 16 年 10 月 14 日 (2004.10.14)

【公開番号】特開 2001-191639 (P2001-191639A)

【公開日】平成 13 年 7 月 17 日 (2001.7.17)

【出願番号】特願 2000-10075 (P2000-10075)

【国際特許分類第 7 版】

B 4 1 M 5/00

B 4 1 J 2/01

【F I】

B 4 1 M 5/00 B

B 4 1 J 3/04 1 0 1 Y

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 9 月 30 日 (2003.9.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

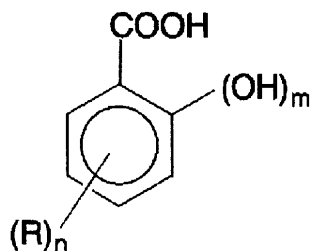
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

支持体上に気相法シリカを主として含有するインク受容層を設けたインクジェット記録用材料において、該インク受容層に下記化 1 の化合物を含有することを特徴とするインクジェット記録材料。

【化 1】



(式中、R はヒドロキシ基を除く置換可能な基を表し、m は 0 または 1、n は 0、1、2 または 3 の整数を表す。)

【請求項 2】

前記インク受容層が更にカチオン性化合物を含有する請求項 1 に記載のインクジェット記録材料。